

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2005 年 9 月 1 日 (01.09.2005)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2005/080454 A1

(51) 国際特許分類⁷: C08F 220/58, C07F 9/24, C08L 33/26, 101/12, C09D 5/24, 101/00, 133/02, 133/26, 159/00, 161/28, 175/04, H01B 1/06, 1/12, H01M 8/02, 8/10

(21) 国際出願番号: PCT/JP2005/002939

(22) 国際出願日: 2005 年 2 月 23 日 (23.02.2005)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願2004-048818 2004 年 2 月 24 日 (24.02.2004) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): ユニケミカル株式会社 (UNI-CHEMICAL CO., LTD.) [JP/JP]; 〒6360824 奈良県生駒郡三郷町城山台 5-1 1-1 2 Nara (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 神崎 吉夫 (KAN-ZAKI, Yoshio) [JP/JP]; 〒6360824 奈良県生駒郡三郷町城山台 5-1 1-1 2 Nara (JP).

(74) 代理人: 高石橘馬 (TAKAISHI, Kitsuma); 〒1620825 東京都新宿区神楽坂 6 丁目 6 7 神楽坂 F Nビル 5 階 Tokyo (JP).

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:
— 国際調査報告書

2 文字コード及び他の略語については、定期発行される各 PCT ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: (METH)ACRYLAMIDE CONTAINING PHOSPHORUS COMPOUND ACID RESIDUE, POLYMER MADE THEREFROM, USE OF THE SAME, AND PROCESSES FOR PRODUCING THESE

(54) 発明の名称: リン系酸残基含有(メタ) アクリルアミド、それを用いた重合体とその用途、及びそれらの製造方法

(57) Abstract: A phosphorus compound acid residue is introduced into an optionally N-substituted (meth)acrylamide monomer. The resultant monomer is polymerized to obtain a (meth)acrylamide polymer which contains the phosphorus compound acid residue and has a high electrolyte group density and excellent conductivity. This polymer is useful as a material for conductive resins, proton-conductive solid polyelectrolyte films, and coating materials.

(57) 要約: N-置換されていてもよい(メタ)アクリルアミド系単量体にリン系酸残基を導入し、得られた単量体を重合すると、高い電解質基密度を有し、導電性に優れたリン系酸残基含有(メタ)アクリルアミド系重合体が得られる。この重合体は、導電性樹脂、プロトン伝導性固体高分子電解質膜及びコーティング剤の材料として有用である。

WO 2005/080454 A1